平成29年度 集積回路設計技術 次世代集積回路工学特論資料

2端子MOS構造

群馬大学 松田順一

1

概要

- ・フラットバンド電圧
- ・電位バランスと電荷バランス
- ・ 表面状態とゲート~基板間電圧
 - ・フラットバンド、蓄積、空乏、反転
 - エネルギーバンド図
- ・反転電荷とゲート~基板間電圧
 - ・ 全体的な解析
 - 強反転
 - 弱反転
- 小信号容量
- フラットバンド電圧と基板濃度の導出
- (注)以下の本を参考に、本資料を作成した。
- (1) Yannis Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor Second Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
- (2) Yannis Tsividis and Colin McAndrew, Operation and Modeling of the MOS Transistor Third Edition, Oxford University Press, New York, 2011.

フラットバンド電圧説明(1)



(3)表面電荷がゼロになる

ように外部電圧_{のMS}印加

(1)ゲートと基板は同一材料

(2)ゲートと基板は異種材料

仕事関数差によりゲートと 基板側にそれぞれ電荷発生

 $\phi_{\rm MS} = \phi_{\rm Bulk_material} - \phi_{\rm gate_material}$

(4)界面電荷Q。の影響

フラットバンド電圧説明(2)



(5)界面電荷の影響を打消す外部電圧印加

$$\psi_{ox} = -Q'_o/C'_{ox}, \quad C'_{ox} = \varepsilon_{ox}/t_{ox}$$

$$V_{FB} = \phi_{MS} - \frac{Q_o'}{C_{ox}}$$

V_{FB} : フラットハ・ント、電圧 *ø_{MS}* : 仕事関数差

$$\phi_{MS} = \phi_{Bulk_material} - \phi_{gate_material} \left(= \frac{W_M - W_S}{q} \right)$$

 $Q'_o:$ 単位面積当りの実効界面電荷
 $C'_{or}:$ 単位面積当りの酸化膜容量

 $n^{+} ポリシリコンゲート p^{+} ポリシリコンゲート$ $\phi_{MS} = -\phi_{F} - 0.56V \qquad \phi_{MS} = -\phi_{F} + 0.56V$

--- `

実効界面電荷 Q。

- 固定電荷
 - ・酸化時にSi-SiO₂界面に形成
- ・酸化膜中のトラップ電荷
 - ・放射線、光エミッション、キャリア注入に起因
- •可動イオン(Na)電荷
 - ・工程での環境に起因
- ・界面トラップ電荷
 - ・界面での欠陥に起因
 - ・基板中のキャリアと電荷の交換あり



電位バランス



ゲート~基板間電圧 $V_{GB} = \psi_{ox} + \psi_s + \phi_{MS}$ 電圧変化のある場合 $\Delta V_{GB} = \Delta \psi_{ox} + \Delta \psi_{s}$ 電荷中性 $Q_{G}^{'} + Q_{o}^{'} + Q_{C}^{'} = 0$ 電荷変化のある場合 $\Delta Q_{G}^{'} + \Delta Q_{C}^{'} = 0$ Q₆:単位面積当りゲート上電荷 Q: 単位面積当り基板内電荷 (注) ここでは、Q を固定して考える。

実際には、界面準位によりQ。は変化する。

フラットバンド状態と蓄積状態



空乏状態と反転状態





表面電荷(電子)密度 $n_{surface} = n_0 e^{\frac{\psi_s}{\phi_t}}$ $= n_i e^{\frac{\psi_s - \phi_F}{\phi_t}}$ $\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}$ $= p_0 e$ $\cong N_A e^{rac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}$

平衡状態 (p型基板)

$$p_{0} \cong N_{A}, \quad n_{0} \cong \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}}$$

$$\phi_{F} = \phi_{t} \ln\left(\frac{n_{i}}{n_{0}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad n_{0} = n_{i} \exp\left(-\frac{\phi_{F}}{\phi_{t}}\right)$$

$$\phi_{F} = \phi_{t} \ln\left(\frac{p_{0}}{n_{i}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad n_{i} = p_{0} \exp\left(-\frac{\phi_{F}}{\phi_{t}}\right)$$

2端子MOS構造のエネルギーバンド図 (蓄積状態と弱反転開始)



11

2端子MOS構造のエネルギーバンド図 (中(緩やかな)反転開始と強反転開始)



中(緩やかな)反転開始 $\phi_{MS} = 0, \quad Q_{o}^{'} = 0$ 強反転開始 $\phi_{MS} = 0, \quad Q_o' = 0$

全体的な解析(ポアソンの式)

·電荷密度

$$\rho(y) = q [p(y) - n(y) - N_A]$$

$$n(y) = n_0 \exp\left(\frac{\psi(y)}{\phi_t}\right), \quad p(y) = p_0 \exp\left(-\frac{\psi(y)}{\phi_t}\right)$$

$$p_0 - n_0 = N_A$$



・ポアソンの式 $\frac{d^2\psi}{dy^2} = \frac{\rho(y)}{\varepsilon_s} = -\frac{q}{\varepsilon_s} \left[p_0(e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1) - n_0(e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1) \right]$

ポアソンの式の解

$$\begin{split} N_A \gg n_i, \quad p_0 &\cong N_A, \quad n_0 \cong \frac{n_i^2}{N_A} = N_A e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_i}} \\ & \forall \neq \exists \forall \vec{\pi} \mathcal{T} \mathcal{V} \mathcal{V} \mathcal{O} \vec{\pi} d\vec{x}, \quad U \in \mathcal{O} \vec{y} \vec{z} \leq \varepsilon_{\sigma} \\ & \frac{d^2 \psi}{dy^2} = -\frac{q N_A}{\varepsilon_s} \left[e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_i}} - 1 - e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_i}} (e^{\frac{\psi(y)}{\phi_i}} - 1) \right] \\ & \overline{m} \mathcal{D} \mathbb{I} \qquad 2 \frac{d\psi}{dy} \quad & \forall j \forall \exists \forall \forall z \neq z \\ 2 \frac{d\psi}{dy} \frac{d^2 \psi}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{d\psi}{dy} \right)^2 \\ & \forall \pi \exists_0 \in \mathcal{I} \quad \forall \pi \forall \forall \tau \neq z \\ & \psi(y) = -\frac{2q N_A}{\varepsilon_s} \left[e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_i}} - 1 - e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_i}} (e^{\frac{\psi(y)}{\phi_i}} - 1) \right] \frac{d}{dy} \\ & \forall \pi \exists_0 \end{bmatrix}$$

$$y:\infty \to y$$
まで積分, 但し $y = \infty$ で $\psi = 0, \frac{d\psi}{dy} = 0$
$$\left(\frac{d\psi}{dy}\right)^{2} = -\frac{2qN_{A}}{\varepsilon_{s}}\int_{0}^{\psi} \left[e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_{t}}} - 1 - e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(e^{\frac{\psi(y)}{\phi_{t}}} - 1)\right]d\psi$$
$$= \frac{2qN_{A}}{\varepsilon_{s}} \left[\phi_{t}e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_{t}}} + \psi - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi(y)}{\phi_{t}}} - \psi - \phi_{t})\right]$$

したがって電界
$$E(y) = -\frac{d\psi}{dy}$$
 は
 $E(y) = \pm \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{\varepsilon_s} \sqrt{\phi_t e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}} + \psi - \phi_t + e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}}(\phi_t e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - \psi - \phi_t)}$
 $\frac{d\psi}{dy}$ となる。
ここで $+:\psi > 0, -:\psi < 0$

半導体中の全電荷と容量

単位面積当りの半導体電荷Qには、以下の如くになる。 $Q_C = -\varepsilon_s E_{surface}, \quad \psi(0) = \psi_s$ $Q_{C} = \mp \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})$ また、 Q'_c に対する容量 $C'_c \equiv -\frac{dQ_c}{dw}$ は $C_{c}^{'} = \pm \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left\{ \frac{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}{2\sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}} (\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})} \right\}$ となる。

反転領域(反転層電荷)

 $\psi_{s} \geq \phi_{F}, \quad p 基板の場合$ $Q_{c}' = -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}\sqrt{\psi_{s}} + \phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}-2\phi_{F}}{\phi_{t}}}$ $Q_{B}' = -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}\sqrt{\psi_{s}}$ となる。ここで、

$$Q_C = Q_I + Q_B$$

から

$$Q_{I}' = -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left(\sqrt{\psi_{s} + \phi_{t}e^{\frac{\psi_{s} - 2\phi_{F}}{\phi_{t}}}} - \sqrt{\psi_{s}}\right)$$

$$\geq \hbar \delta_{0}$$

Q₁:単位面積当りの反転層電荷 Q_B:単位面積当りの空乏層電荷



反転領域(表面電位とゲート電圧)

電圧及び電荷の関係

空波の電荷の関係

$$V_{GB} = \psi_{ox} + \psi_{s} + \phi_{MS}$$

 $Q'_{G} = C'_{ox}\psi_{ox}$
 $Q'_{I} = Q'_{I}(\psi_{s})$
 $Q'_{G} + Q'_{O} + Q'_{I} + Q'_{B} = 0$
 $Q'_{B} = Q'_{B}(\psi_{s})$

ゲート~基板間電圧と表面電位

$$V_{GB} = -\frac{1}{C_{ox}} \Big[Q_{o}' + Q_{I}'(\psi_{s}) + Q_{B}'(\psi_{s}) \Big] + \psi_{s} + \phi_{MS}$$
$$= \phi_{MS} - \frac{Q_{o}'}{C_{ox}'} + \psi_{s} - \frac{Q_{I}'(\psi_{s}) + Q_{B}'(\psi_{s})}{C_{ox}'}$$
$$= V_{FB} + \psi_{s} - \frac{Q_{I}'(\psi_{s}) + Q_{B}'(\psi_{s})}{C_{ox}'}$$

$$\begin{split} V_{GB} &= V_{FB} + \psi_s + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{C_{ox}} \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}} \\ &= V_{FB} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}} \\ &\subseteq \subset \circlearrowright \\ \psi_s &= \phi_F \quad \bigcirc \boxminus \land \land V_{GB} \Rightarrow V_{L0} \\ V_{L0} &= V_{FB} + \phi_F + \gamma \sqrt{\phi_F} \qquad \gamma = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{C_{ox}} \\ \psi_s &= 2\phi_F \quad \oslash \eqqcolon \land \land V_{GB} \Rightarrow V_{M0} \\ V_{M0} &= V_{FB} + 2\phi_F + \gamma \sqrt{2\phi_F} \end{split}$$

V_{L0}:弱反転開始電圧, V_{M0}:中反転開始電圧





表面電位とゲート基板間電圧及び電荷と表面電位



反転領域(反転層電荷とゲート電圧)



強反転領域と強反転領域の電荷

強反転領域の表面電位は、 実効的に一定 $\psi_{s} \cong \phi_{0}$ $\phi_0 = 2\phi_F + \Delta\phi$ この場合の反転層電荷は $Q_{I}^{'} = -C_{ox}^{'} \left(V_{GB} - V_{FB} - \phi_{0} - \gamma \sqrt{\phi_{0}} \right)$ $=-C'_{or}(V_{GR}-V_{T0})$ となる。ここで $V_{T0} = V_{FB} + \phi_0 + \gamma \sqrt{\phi_0}$ である。 V₇₀:外挿しきい値電圧

反転領域の電荷は

$$\begin{split} Q_{I}' &= -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left(\sqrt{\psi_{s}} + \phi_{t} e^{(\psi_{s} - 2\phi_{F})/\phi_{t}} - \sqrt{\psi_{s}} \right) \\ \mathfrak{g} {\rm p} {\rm p} {\rm m} {\rm fig} {\rm ij} \, \mathfrak{O} {\rm lis} \,, \psi_{s} \leq 2\phi_{F} \, \mathfrak{O} \, \mathfrak{h} \, \mathfrak{I} \, \mathfrak{h} \, \mathfrak$$

弱反転領域(反転電荷と表面電位)

反転領域の電荷は

$$Q_{I}' = -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left(\sqrt{\psi_{s} + \phi_{t}e^{(\psi_{s} - 2\phi_{F})/\phi_{t}}} - \sqrt{\psi_{s}}\right)$$

弱反転領域では、 $\psi_s \leq 2\phi_F$ であるから、 $\phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t} = \xi \rangle$ おくと、 $\xi \ll \psi_s$ となるため $\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}} = \sqrt{\psi_s + \xi} \cong \sqrt{\psi_s} \left(1 + \frac{\xi}{2\psi_s}\right)$

したがって、

$$Q_{I}' \cong -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{2\sqrt{\psi_{s}}} \phi_{t} e^{(\psi_{s}-2\phi_{F})/\phi_{t}}$$

弱反転領域(反転電荷とゲート電圧:1)

弱反転領域では、 $\psi_s \leq 2\phi_s$ であるから $V_{GB} = V_{FB} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s} + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}$ $\simeq V_{FR} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s}$ となる。 $\psi_{e} \cong \psi_{e}$ として、上式から ψ_{e} を解くと $\psi_{sa} = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4}} + V_{GB} - V_{FB}\right)^{-1}$ となる。したがって、*Y*_{sa}はV_{GB}の関数になり、 $Q_{I}' = -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{2\sqrt{\psi}(V_{GB})}\phi_{t}e^{[\psi_{sa}(V_{GB})-2\phi_{F}]/\phi_{t}}$

 $\mathbb{L} \subset \mathcal{O}_{n} \sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})} \cong \sqrt{2\phi_{F}} \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{E} \mathcal{E},$ $Q_{I}' = -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{2\sqrt{2\phi_{-}}}\phi_{t}e^{[\psi_{sa}(V_{GB})-2\phi_{F}]/\phi_{t}}$ となる。ここで、 $n = \left(\frac{d\psi_{sa}}{dV_{GB}}\right)^{-1} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}}}$ $n|_{\psi_{sa}=2\phi_F} \cong 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F}} = n_0 \qquad (-\overleftarrow{\mathbb{R}})$ である。

となる。

弱反転領域(反転電荷とゲート電圧:2)

したがって、

$$\begin{split} \psi_{sa} - 2\phi_F &= \frac{1}{n_0} \left(V_{GB} - V_{M0} \right) \\ \succeq \uparrow_S \not \supset_O Q_I \, \forall \not \downarrow \\ Q_I \, \approx - \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{2\phi_F}} \phi_t e^{(V_{GB} - V_{M0})/n_0 \phi_t} \\ &= Q_{M0} \, e^{(V_{GB} - V_{M0})/n_0 \phi_t} \\ \left(Q_{M0} \, = - \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{2\phi_F}} \phi_t \right) \end{split}$$



となる。

反転層電荷とゲート~基板間電圧 $\ln \left| Q_{I} \right|$ (a)(b) _/ $\begin{cases} Q_{I}^{'} = -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left(\sqrt{\psi_{s} + \phi_{t}e^{\frac{\psi_{s} - 2\phi_{F}}{\phi_{t}}}} - \sqrt{\psi_{s}} \right) \\ V_{GB} = V_{FB} + \psi_{s} + \gamma \sqrt{\psi_{s} + \phi_{t}e^{\frac{\psi_{s} - 2\phi_{F}}{\phi_{t}}}} \end{cases}$ (a) < (*c*) (b) $Q_{I}' \approx Q_{M0}' e^{(V_{GB} - V_{M0})/n_{0}\phi_{t}}$ (c) $Q_{I}^{'} = -C_{ox}^{'} (V_{GB} - V_{T0})$ $\rightarrow V_{GB}$ V_{M0} V_{T0} V_{H0} Moderate Weak Strong inversion inversion inversion

小信号容量(ゲート~基板間)

ゲート〜基板間容量(単位面積当り)

$$C_{gb} = \frac{dQ_G}{dV_{GB}}$$

とすると、以下の如くになる。

$$\frac{1}{C_{gb}} = \frac{dV_{GB}}{dQ_G'} = \frac{d\psi_{ox}}{dQ_G'} + \frac{d\psi_s}{dQ_G'}$$

$$= \frac{1}{\frac{dQ_G'}{d\psi_{ox}}} + \frac{1}{-\frac{dQ_C'}{d\psi_s}}$$

$$= \frac{1}{C_{ox}'} + \frac{1}{C_c'}$$

ここで、 $C_{ox} = \frac{dQ_G'}{d\psi_{ox}}, \quad C_C' = -\frac{dQ_C'}{d\psi_s}$





 $\Delta Q_{C}^{'} = -\Delta Q_{G}^{'} \qquad \Delta V_{GB} = \Delta \psi_{ox} + \Delta \psi_{s}$

半導体中の全電荷による小信号容量

$$\begin{split} C_{c}^{'} &= -\frac{dQ_{c}^{'}}{d\psi_{s}} \mathcal{O} \, \texttt{具体的な式} \\ C_{c}^{'} &= \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \begin{cases} \frac{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}} (e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - 1)}{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}} (e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - 1)} \\ \frac{2\sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}} (\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})} \end{cases} \end{split}$$

 $\psi_s > 3\phi_t$ の場合

$$C_{c}' = \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left\{ \frac{\frac{\psi_{s}-2\phi_{F}}{\phi_{t}}}{2\sqrt{\psi_{s}+\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}-2\phi_{F}}{\phi_{t}}}}} \right\}$$

反転層容量の具体的な式

 $y_{z} \epsilon \psi = 0$ のところでの $y(\infty c \epsilon \eta)$ したがって、 C_i は、 ($\psi_s > 3\phi_s$ の場合) とすると、Qは、(p型基板の場合) $C_i' \equiv \frac{-dQ_I}{d\psi_s}$ $Q_I' = -q \int_{0}^{y_c} n(y) dy$ $=qN_{A}e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}\frac{e^{\psi_{s}/\phi_{t}}}{\mathrm{E}(\psi_{s})}$ *Y*_{surface} $= -qN_A e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t} \oint_{s}^{\psi_s}} \frac{e^{\psi(y)/\phi_t}}{F(w)} d\psi$ $\cong q\varepsilon_s N_A e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t} \frac{1}{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}}$ となる。 $= \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \frac{e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}{2\sqrt{\psi_s + \phi_s e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}}$ $n(y) = n_0 e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} \cong N_A e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}} e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}}$ $E = -\frac{d\psi}{dt}$ となる。

空乏層容量の具体的な式

 $\mathbf{E} = -\frac{d\psi}{d\psi}$

dy

$$\begin{split} y_{c} & \xi \psi = 0 \mathcal{O} \ \xi \ \Xi \ \mathcal{J} \ \mathcal{O} \ \mathcalO \ \mathcalO \ \mathcalO} \ \mathcalO \ \mathcalO \ \mathcalO$$



空乏層容量と反転層容量

$$\begin{split} \Delta Q_{c}^{'} &= \Delta Q_{B}^{'} + \Delta Q_{I}^{'} \\ &= \frac{-dQ_{c}^{'}}{d\psi_{s}} = \frac{-dQ_{B}^{'}}{d\psi_{s}} + \frac{-dQ_{I}^{'}}{d\psi_{s}} \\ &\equiv \Xi \subset \mathcal{O}, \\ C_{b}^{'} &= \frac{-dQ_{B}^{'}}{d\psi_{s}}, \quad C_{i}^{'} &= \frac{-dQ_{I}^{'}}{d\psi_{s}} \\ &\geq \forall \mathcal{O} \geq , \\ C_{c}^{'} &= C_{b}^{'} + C_{i}^{'} \\ &\downarrow \mathcal{I} \geq \mathcal{I} \leq \mathcal{I} \leq \mathcal{I}, \quad \mathcal{I} \downarrow \equiv \mathcal{O} \neq \mathcal{I} \notin \mathcal{I} \leq \mathcal{I} \leq \mathcal{I}_{o} \\ &= \frac{1}{C_{gb}^{'}} = \frac{1}{C_{ox}^{'}} + \frac{1}{C_{b}^{'} + C_{i}^{'}} \end{split}$$



ゲート基板間容量とゲート~基板間電圧



表面電位と容量の関係

$$V_{GB} = V_{FB} + \psi_s - \frac{Q'_I(\psi_s) + Q'_B(\psi_s)}{C'_{ox}}$$
$$\frac{dV_{GB}}{d\psi_s} = 1 + \frac{1}{C'_{ox}} \left(C'_b + C'_i\right)$$
$$\therefore \frac{d\psi_s}{dV_{GB}} = \frac{C'_{ox}}{C'_{ox} + C'_b + C'_i}$$

弱反転領域では、 $C_b^{'} \gg C_i^{'}$ であるため

$$\frac{d\psi_{s}}{dV_{GB}} = \frac{C_{ox}}{C_{ox} + C_{b}}$$

$$\geq \tau_{s} \mathcal{Z}_{o}$$

$$C_{b}' \equiv \frac{-dQ_{B}'}{d\psi_{s}}$$
$$C_{i}' \equiv \frac{-dQ_{I}'}{d\psi_{s}}$$

したガジ つて、

$$n \equiv \left(\frac{d\psi_s}{dV_{GB}}\right)^{-1} = 1 + \frac{C_b}{C_{ox}}$$

$$= 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_s}} \cong 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}}}$$

となる。また、界面準定による容量も考慮すると

$$n = 1 + \frac{C_{b}' + C_{it}}{C_{OX}'}$$

となる。ここで、
$$C'_{it} \equiv \frac{-dQ_{it}}{d\psi_s}$$
である。
 C'_{it} は C'_{b} と C'_{i} に並列になる。

フラットバンド容量
$$C_{FB}^{'}$$
は、
 $C_{FB}^{'} = \lim_{\psi_{s} \to 0} C_{c}^{'}$
 $C_{c}^{'} = \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left[\frac{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - 1)}{2\sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})}} \right]$
である。 $\psi_{s} \to 0$ で、[]の中は、 $\frac{0}{0}$ となるので、
 $e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} \approx 1 + \left(-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}\right)^{2}$

として、ψ_s→0にすると、極限値が求まる。この極限値は、以下となる。

$$C_{FB} = \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\frac{1 + e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}}}{2\phi_t}} \approx \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\frac{1}{2\phi_t}} = \frac{\varepsilon_s}{\lambda_p} \qquad \left[(\exists \ U, \ \lambda_p = \left(\phi_t \frac{\varepsilon_s}{qN_A}\right)^{\frac{1}{2}} : \ \forall \forall \notin E \right]$$

基板不純物密度の導出方法

高周波C-Vのゲート〜基板間の最大容量値 C_{gbmax} は、 $C_{gbmax} = C_{ox}$ (蓄積状態) である。また、反転層が形成された後の空乏層容量は

$$C_{dm} = \frac{\varepsilon_s}{d_{Bm}} A = \frac{\varepsilon_s}{\sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{qN_A}}} A = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{2\phi_F}} A \qquad (A: \begin{tabular}{l} & \end{tabular} (A: \begin{tabular}{l} & \end{tabular} & \end{tabular} \\ \hline & \end{tabular} \end{tabular}$$

である。この場合、ゲート〜基板間の最小容量値 C_{gbmin} は、

$$\frac{1}{C_{gb\min}} = \frac{1}{C_{gb\max}} + \frac{1}{C_{dm}}$$

となる。これから以下を得る。

$$C_{dm} = \frac{C_{gb\max}C_{gb\min}}{C_{gb\max} - C_{gb\min}}$$

測定値 C_{gbmax} と C_{gbmin} から C_{dm} を求めると、 C_{dm} の上式から N_A を決定できる。

フラットバンド電圧の導出方法

高周波C-Vから求めた基板不純物密度を用いると、フラットバンド容量は、

$$C_{FB} \approx \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\frac{1}{2\phi_t}} A$$
 (A:容量面積)

で与えられる。この場合、フラットバンド電圧印加時のゲート~基板間容量C_{gbFB}は、

$$C_{gbFB} = \frac{C_{ox}C_{FB}}{C_{ox} + C_{FB}} = \frac{C_{gb\max}C_{FB}}{C_{gb\max} + C_{FB}}$$

となる。すなわち、

$$\frac{C_{gbFB}}{C_{gb\max}} = \frac{C_{FB}}{C_{gb\max} + C_{FB}}$$

とし、右辺を実測から求めると、 C_{gbFB}/C_{gbmax} を決定できる。これから、 V_{FB} が求まる。